九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository

# キトサンおよびその誘導体の分析化学への応用

倉内, 芳秋

https://doi.org/10.11501/3150975

出版情報:九州大学, 1998, 博士(工学), 論文博士 バージョン: 権利関係: キトサンおよびその誘導体の分析化学への応用

倉 内 芳 秋

# キトサンおよびその誘導体の分析化学への応用

0

平成10年11月

倉 内 芳 秋

目次				
				1
第1章 序論	•	•	•	1
1.1 研究の背景と目的	•	•	•	1
1.2 本論文の概要	•	•		3
参考文献	Ċ	•		4
第2章 金属イオンセンサプローブとしての利用				6
2.1 N-(2-ヒドロキシベンジル)キトサン修飾電極による銅および				
鉛イオンの微量分析	•		•	8
2.1.1 試薬および装置	•	•	•	8
2.1.2 N-(2-ヒドロキシベンジル)キトサンの合成	•	•	•	8
2.1.3 修飾電極の作製	•	•	•	9
2.1.4 サイクリックボルタンメトリー	•	•	•	• 10
2.1.5 結果と考察	•	•	•	• 11
2.1.5.1 N-(2-ヒドロキシベンジル)キトサンの合成	•	•		• 11
2.1.5.2 修飾電極の作製	•	•		• 11
2.1.5.3 金属イオンの測定	•	•		• 14
2.2 ピリドキサール類似体で修飾したキトサンを感応部とする				
光ファイバ蛍光センサを用いた亜鉛イオンの定量	•	•		• 19
2.2.1 試薬および装置	•			• 19
2.2.2 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-2-				
メチルピリジンによるキトサンの修飾	•			• 20
2.2.2.1 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-				
2-メチルピリジンの合成	•		•	• 22
2.2.2.2 キトサンのブロモアセチル誘導体の合成	•		•	• 24
2.2.2.3 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-				
2-メチルピリジンでの修飾	•		•	• 25
2.2.3 プローブの作製と蛍光測定			•	• 25
2.2.4 結果と考察			•	• 26
2.2.4.1 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-				
2-メチルピリジンの同定			•	• 26

	2.2.4.2	5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-				
		2-メチルピリジンによるキトサンの修飾	•	•	•	30
	2.2.4.3	5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-				
		2-メチルピリジン修飾キトサンの紫外可視および				
		蛍光スペクトル	•	•	•	33
	2.2.4.4	センサの応答特性	•	•	•	36
2.3	総括		•	•	•	40
参考	文献		•	•	•	41

第3章 ピレン誘導体で修飾したキトサンを感応部とする有機溶媒中

微	量水分測定用光ファイバ蛍光センサ		• • 43
3.1 実験			• • 44
3.1.1	試薬および装置	• •	• • 44
3.1.2	1-カルボキシプロピルフォルミルピレンの合成	• •	• • 45
3.1.3	1-カルボキシプロピルフォルミルピレン修飾キトサン	候の	調製
		•	••47
3.1.4	光ファイバへのキトサン膜の被覆と1-カルボキシプロ	リピル	,
	フォルミルピレンによる修飾		• • 47
3.2 結果	と考察	•	• • 49
3.2.1	1-カルボキシプロピルフォルミルピレンの同定		••49
3.2.2	1-カルボキシプロピルフォルミルピレンによる修飾		
	キトサン膜の分析		•• <b>5</b> 4
3.2.3	有機溶媒中の水含量測定	•	· · 57
3.3 総括	i de la companya de l		· · 57
参考文献			• • 60

第4章 キトサン複合膜をクラッドとする内部全反射型光ファイバセンサの

	水	中有机	幾溶媒に対する応答および酒類中エタノール定量への応用	Ð	•	• (	61
4.	.1	応答	幾構	•	•	•	62
4.	.2	実験		•	•	•	63
	4.	2.1	試薬	•	•	•	64
	4.	2.2	センサ応答部位の作製	•	•		64

4.2.3	装置組立と測定手順	• • • 65
4.2.4	電子顕微鏡による表面観測	• • • 68
4.3 水中	有機溶媒への応答	• • • 68
4.3.1	応答特性	• • • 70
4.3.2	応答量と屈折率および収縮率	• • • 70
4.3.3	応答機構の実証	· · · 73
4.3.4	テフロンコーティングと応答速度	• • • 75
4.3.5	塩素化炭化水素への応答	• • • 75
4.4 酒類	領中エタノール定量への応用	• • • 77
4.4.1	応答曲線と耐久性および再現性	• • • 77
4.4.2	グルタルアルデヒド架橋の効果	• • • 77
4.4.3	酒類への適用	• • • 84
4.5 総括	5	• • • 87
参考文献		• • • 87

第5章 色素	修飾キトサン複合膜をクラッドとする内部全反射型				
光	ファイバセンサの有機酸に対する応答特性	•	•	•	89
5.1 実験		•	•	•	90
5.1.1	試薬	•	•	•	90
5.1.2	センサ作製と装置組立および測定手順	•	•	•	91
5.1.3	色素の吸収スペクトルおよび膜への吸着	•	•	•	92
5.2 結果	および考察	•	•	•	93
5.2.1	グルタルアルデヒド架橋の影響および有機酸応答選択性	2			
		•	•	•	93
5.2.2	色素の紫外可視吸収スペクトル	•	•	•	96
5.2.3	検出波長特性	•	•	•	100
5.2.4	色素の構造と応答の関係	•	•	•	101
5.2.5	膜への色素吸着量	•	•	•	103
5.2.6	色素吸着膜の膨潤率および屈折率	•	•	•	105
5.2.7	テフロン保護膜と応答速度	•	•	•	105
5.2.8	有機酸の構造と応答	•	•	•	107
5.2.9	テフロンコーティングおよび食酢中の有機酸含量の定量	ł	•	•	113

5.3 総括	••• 115
参考文献	••• 116
第6章 β-シクロデキストリンで修飾したキトサンの分子認識	•••117
6.1 実験	•••119
6.1.1 試薬および装置	•••119
6.1.2 N-(カルボキシメチル)キトサンの合成	• • • 121
6.1.3 モノ(6-アミノ-6-デオキシ)-β-シクロデキストリンの	合成・123
6.1.3.1 β-シクロデキストリンのモノトシル化	•••123
6.1.3.2 モノ(6-O-p-トリルスルホニル)-β-シクロデキス	トリン
のアジド化	•••124
6.1.3.3 モノ(6-アジド-6-デオキシ)-β-シクロデキストリ	>
の還元	•••124
6.1.3.4 モノ(G-アミノ-G-デオキシ)-β-シクロデキストリ	2
の精製	· · · 125
6.1.3.5 総括	•••125
6.1.4 β-シクロデキストリン修飾キトサンの合成	· · · 126
6.1.4.1 アミノ化β-シクロデキストリンとN-カルボキシ	
メチルキトサンの縮合	•••127
6.1.5 β-シクロデキストリン修飾キトサンのシリカゲルへ	
の固定	· · · 128
6.1.5.1 シリカゲルへのオキシラン環の導入	•••129
6.1.5.2 β-シクロデキストリン修飾キトサンのシリカゲル	うろ
固定およびカラムの作製	· · · 130
6.1.6 アミノ酸および類似化合物の2,4-ジニトロフェニル	
誘導体化	•••130
6.1.6.1 D-アラニンの2,4-ジニトロフェニル誘導体化	· · · 131
6.1.6.2 DL-フェニルアラニンメチルエステルの2,4-	
ジニトロフェニル誘導体化	· · · 132
6.1.6.3 DL-シトルリンの2,4-ジニトロフェニル誘導体化	· · · 132
6.1.6.4 (R)-(+)-2-アミノ-3-フェニル-1-プロパノールの	

	2,4-ジニトロフェニル誘導体化	•••133
6.2 結果およ	び考察	· · · 133
6.2.1 +1	、サンおよびN-カルボキシメチルキトサンの構造	•••133
6.2.2 T	ミノ化β-シクロデキストリンの合成と同定	•••142
6.2.2.1	β-シクロデキストリンのモノトシル化	•••142
6.2.2.2	モノ(6-O-p-トリルスルホニル)-β-シクロデキス	トリンの
	アジド化	•••147
6.2.2.3	モノ(6-アジド-6-デオキシ)-β-シクロデキストリ	リンの還元
		•••147
6.2.2.4	モノ(6-アミノ-6-デオキシ)-β-シクロデキストリ	リンの精製
		•••149
6.2.3 β-	シクロデキストリン修飾キトサンの構造	· · · 151
6.2.4 β-	シクロデキストリン修飾キトサンのシリカゲルへの	の固定
		• • • 160
6.2.4.1	シリカゲルへのオキシラン環の導入	••• 160
6.2.4.2	シリカゲルへのβ-シクロデキストリン修飾キト・	サンの導入
		••• 160
6.2.5 HI	PLCによるキラル分離	•••162
6.2.6 NM	ARによるキラル分離機構の検討	•••171
6.2.6.1	2,4-ジニトロフェニルトリプトファン/β-シク	ロデキ
4	ストリン修飾キトサン包接錯体のNMRスペクト	$\nu \cdot \cdot \cdot 173$
6.2.6.2	2,4-ジニトロフェニルアラニン/β-シクロデキ	ストリン
	修飾キトサン包接錯体のNMRスペクトル	· · · 175
6.2.6.3	β-シクロデキストリン包接錯体の解離定数	•••177
6.3 総括		•••180
参考文献		· · · 183
第7章 結論		••• 186
謝辞		••• 190

#### 第1章 序論

#### 1.1 研究の背景と目的

N-アセチルグルコサミンがβ-1,4結合で直鎖状に連なったアミノ多糖であるキチンは、セルロースに次いで自然界に大量に存在するポリマーであり、エビ、カニ、昆虫の外殻などにタンパク質や炭酸カルシウムなどと結合したキチン質として存在している。分子構造は、Fig.1-1に示したようにセルロースと類似しており、セルロースの2位のヒドロキシル基がアセトアミド基に置き換わっているだけである。キチンは溶解性が低く取り扱いが困難なポリマーであるが、濃いアルカリ中で脱アセチル化するとキトサンが得られる(Fig.1-1). 中でも均一系でランダムに45~55%脱アセチル化したものは水溶性を示すようになり取り扱いやすくなる<sup>1)</sup>.



Fig. 1-1 Structures of cellulose, chitin and chitosan.

キチンとキトサンは組成による厳密な区別がなされていないが、市販キトサンは脱アセチル化度が80~85%程度であり、それ以上のものを一般にキトサンと呼んでいる。キトサンの精製品は白色の微粉末の状態で供給される。また、キトサンはアミノ基を構成ユニットに有しているため、蟻酸、酢酸などの有機酸中ではそれぞれの塩として溶解し水溶液とすることが出来る。

キトサンの産業的利用はセルロースのそれと比較すると非常に遅れており, 近年その優れた性質が注目され活発に研究がなされ始めている. 従来よりもっ とも広く応用されてきたのは水処理への利用である. 高分子凝集剤としての利 用は,安全性への配慮から合成系のそれが利用できない場合, 例えばタンパク 質の回収再利用などにおいて利点を発揮する. また, ポリアクリル酸ナトリウ ムとの併用による汚泥脱水法CSAシステムも開発されている2,3).

一方,このような原材料的な利用以外に、キトサンが有するさまざまな特性 を積極的に利用した研究がなされている.たとえば、高い成膜性と親水性を利 用した、浸透気化法や気化浸透法によるアルコール分離膜<sup>4)</sup>および膜中のアミ ノ基をキャリアーとする核酸塩基の輸送膜<sup>5)</sup>に関する浦上らの分離膜材として の研究、高い金属吸着能および化学修飾の容易さに注目し、高度にキレート形 成機能を強化した修飾体による金属イオン分離材料としての利用<sup>6,7)</sup>などがあ る.また、キトサン自身を多孔質ビーズ化して生体触媒の固定化担体としたも の<sup>8)</sup>はキトパールの名称で市販もされており、母体となるキトサンが安全性に 優れていることから、食品や医薬品の製造プロセスにおいて積極的に利用され ている.これら以外にも、カプセル化細胞培養の膜材料<sup>9)</sup>や化粧品<sup>10)</sup>、食 品<sup>11)</sup>、土壌改良材<sup>12)</sup>など多方面での利用が報告されている.

キトサンの有する化学的特性や機能をまとめると、(1)アミノ基に由来す る金属イオン配位能が高い、(2)親水性が高い、(3)可溶性のため成形が容 易であり、成膜性も高い、(4)化学修飾が容易である、(5)ポリマー中にキ ラル中心が多数あるため、キラル分離の固定相としての潜在能力を有する、

(6)構成単位をグルコサミンとする重合体のためポリマー鎖の決まった位置 に規則的に修飾部位を導入できる,(7)接触溶媒の極性の違いにより膨潤収 縮性を示す,(8)元来天然物由来のため食品,化粧品産業などへの利用に際 して安全性に優れていることなどが挙げられる.化学修飾により,キトサンの 元来有するこれらの機能・特性を増強または新たな機能を付与した新しい材料 を創生すると,広範な分野での高度な利用が可能性となる.

本研究の目的は、上述したようなキトサンの有するさまざまな化学的特性や 機能を高度化した化学修飾体を合成し、それを化学センサの応答部位あるいは HPLCにおけるキラル固定相へ用いて分析化学的な利用を図ることである.キ トサンを化学修飾し積極的にその特性を高度化して利用する研究はまだその緒 についたばかりであり、機能性新素材としての魅力を十分備えた天然高分子と して、その利用・発展が大いに期待されるものである.

なお,本論文中で作製した,応答原理の異なるそれぞれのセンサがターゲットとしている分析対象物の研究背景,および従来報告されているそれらの分析

方法等に関しては、第2章以降の各章毎に詳述する.

#### 1.2 本論文の概要

本論文は7章から構成されている.

第1章は序論で、キトサンの構造から期待できる化学的特性、およびその性質とキトサンの従来における産業的利用との関連性について述べた.

第2章では、キトサンのもっとも基本的な性質である、金属イオンに対する 親和性の高さをベースにして、化学修飾により特定の金属イオンに対する選択 性を高めた修飾体の合成、及びその金属イオンセンサへの利用について述べ た.タイプの異なる2つのセンサを作製し、それぞれの応答特性について検討 した.まず*N*-(2-ヒドロキシベンジル)キトサン膜を応答部位としたグラッシー カーボン修飾電極を作用極とする、サイクリックボルタンメトリー法により、 銅と鉛イオンの選択的な分析に関して述べた、次に、ピリドキサール類似体で 修飾したキトサン膜を応答部位とする二股型蛍光光ファイバセンサの、亜鉛イ オンに対する選択的な応答について述べた.

第3章では、キトサンの親水性の高さを利用した、微量水分分析用の光ファ イバセンサについて述べた. ピレンカルボキシアルデヒド誘導体で修飾したキ トサン膜は、有機溶媒中で強い蛍光を発する. 微量水分の存在はこの蛍光強度 の低下を引き起こすため、有機溶媒中の微量水分定量用の蛍光センサ感応膜と しての利用を可能にした.

第4章では、キトサンの水と有機溶媒に対する膨潤収縮性の違いを利用した、水中有機溶媒測定用の内部全反射型の光ファイバセンサを作製した.クラッドを剥離した石英光ファイバにキトサン/ポリビニールアルコール(PVA) 膜を新たにクラッドとして被覆したロッドを応答部とする光ファイバセンサの、水中有機溶媒に対する応答原理を明らかにするとともに、各種有機溶媒の比誘電率、蒸気圧およびキトサン/PVA膜に与える収縮率や屈折率の変化と応答特性との関連性を検討した.テフロン保護膜の効果に関しても述べた.また、応用例として、水中ハロゲン化炭化水素及びエタノールの定量を取り上げ、特にエタノールに関しては各種酒類中のアルコールセンサとしての実用性を明らかにし、リアルタイムな分析法として工程管理などへの利用を示唆し

第5章では,前章のキトサン/PVA感応膜をスルフォフタレイン色素で修飾 することで酸への選択性を高めることができることを述べた.色素の種類,吸 着量の応答に与える影響を検討した.有機酸の構造と応答の関係より,より疎 水的な置換基を有する有機酸に対する応答感度が高いことが分かった.また, 実試料分析に際してのテフロン保護膜の効果に関しても述べた.

第6章では、キトサンが潜在的に有するキラル認識能の発現に関して検討した. β-シクロデキストリンで修飾したN-カルボキシメチルキトサン(β-CD-NCMC)を合成しその構造を明らかにした.次にβ-CD-NCMCを共有結 合で固定化したシリカゲルがDNP-アミノ酸のキラルHPLC分離に有効な固定 相として働くことを述べた.種々のDNP-アミノ酸のキラル分離を検討した結 果、β-CD-NCMCはDNP部位とアミノ酸の置換基部位間の距離、及び置換基 部位の大きさによってDNP-アミノ酸を厳密にキラル認識していることを明ら かにした.さらにHPLCの結果とNMRを用いた包接挙動の検討から、高密度 にβ-CDで置換されたβ-CD-NCMCは、隣接する2つのCD環にDNP-アミノ 酸の二つの疎水部位が協同的に包接されるような場を提供していること、ま た、環への浅い包接が高いキラル分離発現に必要であること、さらにはDNP -アミノ酸のカルボキシル基とβ-CD-NCMC間の水素結合も重要な役割を果た していることを示唆した.

第7章は総括的結論で、本研究で得られた結果を総括した.

以上,本論文ではキトサンが本来有するいくつかの特性,機能を化学修飾に より積極的に高度化して,得られた修飾体を種々のタイプのセンサプローブや キラル固定相とすることで分析化学的な利用を図った.

#### 参考文献

た.

1) K. Kurita, T. Sannan, Y. Iwakura : Makromol. Chem, 178, 3197 (1977).

2) 橋本正憲, 石井保彦, 大井康裕: 日本特許公開公報, 昭 59-33440 (1980).

3) 大井康裕, 橋本正憲: PPM, 12, 6, 32 (1981).

4) T. Uragami, K. Takigawa : Polymer, 31, 668 (1990).

- 5) T. Uragami, T. Kato, H. Nagayasu, I. Yura : Carbohydr. Polym., 21, 289 (1993).
- 6) 井上勝利: 分離技術, 26, 286 (1996).
- 7) 井上勝利, 大渡啓介, 吉塚和治, 新原隆司, 喜納兼勇, 分析化学(Bunseki Kagaku), 44, 283 (1995).
- 8) 谷辺博昭: "キチン・キトサンの応用", キチン・キトサン研究会編, p. 123 (1990), (技報堂出版).
- 9) T. Yoshioka, R. Hirano, T. Shioya, M. Kato, *Biotechnol, and Bioeng.*, **35**, 66 (1990).
- 10) 三田康蔵: "キチンキトサンの開発と応用", p. 202 (1987), (工業技術会).
- 11) 平野茂博: "別冊フードケミカル,キチン/キトサンの科学", p. 1 (1987), (食品化学新聞社).
- 12) K. Adachi, M. Kobayashi, E. Takahashi : Solid. Sci. Plant. Nutr., 33, 245 (1987).

# 第2章 金属イオンセンサプローブとしての利用

金属イオンに対する高いキレート形成能<sup>1)</sup> はキトサンのもつ化学的な特性の うち,もっともプリミティブな性質である.キトサンを化学修飾して,この特 性をさらに改質・改善して分析化学的に利用することは初めに検討されるべき テーマであろう.

キトサンのキレート形成能は、その構成単位である 2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコースつまりグルコサミンの2位のアミノ基に由来する.このアミノ基 を化学修飾することでキトサンのもつキレート形成能が変化・向上することは よく知られている。例えば、N-(2-ヒドロキシベンジル)キトサン(HBC)の銅イ オンに対する吸着容量はキトサン自身より47倍も増加することが報告されてい る<sup>2)</sup>.また、一連のコンプレキサン型の配位子、例えばエチレンジアミン四酢 酸やジエチレントリアミン五酢酸で修飾したキトサンは鉛イオンに対して選択 的な吸着を示すようになる<sup>3,4)</sup>.興味あることに、キトサンを前もって銅イオ ンと錯体を形成させた状態でクロロメチルオキシランを用いて架橋したもの は、銅イオン吸着の選択性が増加し、いわゆる鋳型効果を示すことはすでに 我々が報告した現象である<sup>5)</sup>.

一方,従来より,金属イオンに対して選択的な,あるいは濃縮効果のある媒体や試薬で修飾された電極を用いた,ボルタンメトリックな定量が多数報告されている.よく利用されるのは,2,9-ジメチル-1,10-フェナントロリン<sup>6</sup>)やビス(カルボキシメチル)アミノ基を有する架橋処理したポリスチレンなどのキレート配位子である.上述したように,キトサンやその誘導体も高いキレート形成能を有しているため同じような修飾電極膜材料として有効な働きをすると期待される.本章の前半部分では,HBCで修飾したグラッシーカーボン電極を用いるサイクリックボルタンメトリーによる銅,鉛イオンの定量について述べる.このボルタンメトリーはレセプター機能をもつHBCとトランスデューサー機能をもつ電気化学デバイスを構成要素とするセンサと考えることができ,選択性は配位子であるHBCのキレート生成定数の金属イオン間での差および生成したキレートの還元電位の違いから発現している.本章の後半部分ではキトサンとピリドキサール類似体(5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-

2-メチルピリジン: FHMP) から形成したシッフ塩基を応答部位とする高感度 の光ファイバ亜鉛センサについて述べる.光ファイバセンサは、電気的なノイ ズの妨害を受けない、生体試料中のin vivo分析が可能なように微小化が容易で ある、遠隔測定に適している、リアルタイムな分析が可能であるなどの利点を 有しており、その形状を含めた一般的な作製法は多数提案されている。例え ば、 蛍光性試薬の2'.3.4',5.7-ペンタヒドロキシフラボン(モリン)を羊の筋肉 から得られた生体膜7)やセルロース粉末8)に固定化させた二股型光ファイバ ヤンサでアルミニウムが定量されている. またスチレン-ジビニルベンゼンの マイクロビーズに吸着させた1,5-ジフェニルカルボヒドラジドの吸光度変化に よる光ファイバセンサを用いた1ppm 以下の六価クロムの定量<sup>9)</sup> や. 可塑化 したPVC膜中にカリックスアレンとクロモイオノフォアー(一連のフェノキサ ジン誘導体)を取り込ませたナトリウム10)およびカリウムイオン11)のセン サ. さらにはナフィオン膜に1-(2'- ピリジルアゾ)-2-ナフトールを吸着させた ものを応答部位とするセンサでの10-5 mol dm-3レベルのニッケルイオンの定 量<sup>12)</sup>,また銀イオンに選択的なアクリジニウム色素をPVC応答膜に含んだ銀 イオン光ファイバセンサ13) など非常に多彩な膜材料と応答性物質の組み合わ せでなされているが,構成の基本概念は,すでに溶液系で金属イオンとの反応 が知られているクロモフォアやフルオロフォアのセンサ応答膜への固定が基礎 になっている.

一方,一般的に芳香族のシッフ塩基の金属錯体は蛍光性を示すことが知られ ており,亜鉛<sup>14)</sup>,アルミニウム<sup>15,16)</sup>,マグネシウム<sup>17)</sup>,ガリウム<sup>18)</sup>およ びベリリウム<sup>19)</sup>の各イオンの定量に用いられている.また,これらのうちの いくつかは血漿<sup>17)</sup>,人の尿<sup>18)</sup>,ベリリウム銅合金<sup>18,19)</sup>などの実試料に応用 され高い感度と選択性が報告されている.これらのことは、シッフ塩基を容 易に形成するキトサンの場合にもこれらの金属イオン蛍光分析への応用が可能 なことを示唆している.事実,前田らはピリドキサールとアミノ糖とのシッフ 塩基亜鉛キレートの強い蛍光を利用した亜鉛イオンの分析について報告してい る<sup>20)</sup>.本実験でも当初は発蛍光性部位の構築にピリドキサールで修飾したキ トサンを用いることを試みた.しかし、得られた修飾体がどの溶媒にも不溶で 利用できなかったこともあって、ピリドキサールの代わりにその類似体である

FHMPとキトサンとのシッフ塩基を用いた.なお、この報告の後、炭酸脱水素 酵素の活性部位に亜鉛が存在する時のみに同じサイトにダンシルアミドの取り 込みが起こり、強い蛍光を発するようになるという原理を利用した光ファイバ 蛍光バイオセンサによって数十から千nmol dm<sup>-3</sup>の亜鉛定量が報告された<sup>21)</sup>.

# 2.1 N-(2-ヒドロキシベンジル)キトサン修飾電極による銅および鉛イ

#### オンの微量分析

# 2.1.1 試薬および装置

キトサンは加ト吉製の脱アセチル化率95%のもの(100L, YJ24-M)を用いた.水は逆浸透純水装置(ミリポア, Milli-RO15)とイオン交換装置(ヤマトWA-550)を通したものを使用した.サリチルアルデヒド(SA)は和光一級を減圧蒸留後、アセトニトリルは水素化カルシウム存在下蒸留したものを用いた.*N,N-ジシクロへキシルカルボジイミド(DCC)は、和光一級品を使用直前に減圧蒸留して用いた.銅、鉛、ニッケル、コバルト、ウラニル、カドミウムの各硝酸塩は和光特級品をそのまま使用した.電極用のグラッシーカーボン(GC)は東海カーボンRA-6-300, GC-30S(直径6mm)を用いた.電極の鏡面研磨には研磨布(不二見研磨Surfin 018-3)と研磨剤(不二見研磨Metapolish F. M. No. 4. 粒径=0.5 µm)を用いた.その他の試薬は和光特級をそのまま用いた.* 

IRスペクトルは日立製 270-50型赤外分光光度計で得た.サイクリックボル タンメトリーは北斗電工HA-301型ポテンションスタットとHB-104型ファン クションジェネレーターおよび横河3086X-Yレコーダーを用いて行った. 測定には銀・塩化銀電極と白金電極をそれぞれ参照電極および対電極としたH 型三極セルを用いた.

# 2.1.2 N-(2-ヒドロキシベンジル) キトサンの合成

平野ら<sup>22)</sup> とHallら<sup>2)</sup> の方法に従って合成した(Scheme 2-1).キトサン 112mg(グルコサミンユニットに換算して6.96 x 10<sup>-4</sup> mol )を2%酢酸水溶 液10mlに溶解させた後, SA42.4mg(3.48x10<sup>-4</sup> mol )を含むメタノール 10mlを加え室温で30分間撹拌すると黄色のシッフ塩基が生成した.これにシ アノ水素化ホウ素ナトリウム42.4mg(6.75x10<sup>-4</sup> mol )を含む水0.5mlを添加



Scheme 2-1 Synthesis of HBC

すると溶液の色が消失した.室温で一晩撹拌後1mol dm<sup>-3</sup>水酸化ナトリウム水 溶液でpH8.0にすると白色ゲルが生じた.水120ml(40 mlx3)とメタノール 80ml(40mlx2)で洗浄後凍結乾燥して白色粉体のHBCを得た.

# 2.1.3 修飾電極の作製



#### Fig. 2-1 Structure of a GC electrode modified with HBC

作製したGC電極の構造をFig. 2-1 に示す.まず長さ8cmにカットしたテフ ロンスパゲッティチューブの片端を加熱して柔らかくした後,長さ5mmに カットした直径6mmのGCをはめ込み銅線を導電性接着剤で接着し,テフロ ン栓で脱着しないように押さえた.次に,GCの表面を1200番エメリー紙とア ルミナ研磨剤で鏡面研磨した後,GC先端部を61%硝酸に室温で30分間浸漬 し,さらに濃硫酸に170℃60分間浸漬して表面を酸化した<sup>23)</sup>.これを蒸留水 に30分間浸漬洗浄後120℃で2時間乾燥した. 続いて,GC表面にHBC溶液( HBC4mgを1mlの30%メタノール/2%酢酸水溶液に溶解したもの)10µlを 滴下して120℃で14時間乾燥させて製膜した.その後直ちにDCC2gを含む DMF-アセトニトリル(1:1)20ml中,室温で24時間反応させた.次にDMF, 2%酢酸水溶液,水の順にそれぞれ30分浸漬洗浄した.以上の操作(Scheme 2-2)により得られた電極は0.05mol dm<sup>-3</sup>の硝酸カリウム水溶液中に浸して保 存した.



Scheme 2-2 Modification of a GC electrode with HBC

# 2.1.4 サイクリックボルタンメトリー

所定濃度の金属イオンを含む0.05mol dm<sup>-3</sup>の硝酸カリウム水溶液中に修飾 電極を一定時間浸漬した後,少量の水で洗った.その電極を,前もって窒素ガ スをバブリングして脱酸素した,0.05mol dm<sup>-3</sup>の硝酸カリウム水溶液を満た したCV測定用のH型三極セル装置にセットし,25.0±0.5℃の一定温度下で CVを測定した.取り込まれた金属イオンは、CVにより一旦還元した後酸化し その酸化ピーク面積で評価した.再現性のあるピークを得るため,測定は取り 込み後の1回目のボルタモグラムで評価した.繰り返し測定する場合,電極を 0.1 mol dm<sup>-3</sup> EDTA水溶液に10分間浸漬した後,水に30分浸漬洗浄してから 次の測定に移った.

#### 2.1.5 結果と考察

#### 2.1.5.1 N-(2-ヒドロキシベンジル) キトサンの合成

IRスペクトル (Fig. 2-2(b)) から, SAとの反応で新たに1640cm<sup>-1</sup>のイミノ 基の吸収および760cm<sup>-1</sup>に芳香環の吸収が見られたことからシッフ塩基の生成 が確認できた.これを還元すると芳香環の吸収は残っているが1640cm<sup>-1</sup>の シッフ塩基の吸収が消失した (Fig. 2-2(c)).また,1650cm<sup>-1</sup>および 1100cm<sup>-1</sup>付近の吸収が残っていることから,一級アミノ基の残存も示唆して おり,キトサンのアミノ基を一部残した形でのヒドロキシベンジル基のキトサ ンへの導入は目的どおり行われていると判断した.

#### 2.1.5.2 修飾電極の作製

修飾電極の作製方法についてキトサン膜を用いてあらかじめ検討した。Fig. 2-3(a)は酸化処理したGC電極に未修飾のキトサン膜を製膜した場合のサイク リックボルタモグラムである。鉛イオンの酸化ピークのみが-0.57Vにわずか に見られるのみで、キトサン膜への濃縮量が少ないかあるいは膜の密着性が悪 く、電気二重層内に鉛イオンが少量しか存在しないことを示唆した.また、2 回目以降の測定ではほとんどピークが見られず、CV操作後の膜の剥離も見ら れたことから、物理吸着のみによる膜調製法では不都合なことが分かった.こ れをDCCで処理しGCにキトサンを共有結合させると安定な膜が得られ、繰り 返し測定が可能になった、また感度も増加し(Fig. 2-3(b))取り込まれた鉛イ オンが還元され続いて酸化反応を受けるほど十分に電極表面に接近しているこ とを示唆する. Fig. 2-3(c)はDCC処理したHBC修飾電極の結果である. DCC 処理のキトサン膜に比較しさらに感度が5倍ほど増大した. これらのピークは Pb<sup>2+</sup>の2電子還元・酸化に起因していると考えた.なおDCCによりHBC膜を 共有結合させた後のGC鏡面には薄膜による干渉縞がみられ、処理前の膜状態 と全く同じであったことから、反応による膜表面の劣化や剥離は起こっていな いと判断した.以上述べた3種類の電極のそれぞれの膜は調製時にグルコサミ ンユニットのモル数が同じになるように調製した. それぞれの酸化電位の違い は鉛イオンが異なる配位形態によって膜中に取り込まれていることを示してい





Fig. 2-2 IR spectra of (a) chitosan , (b) salicylidenechitosan and (c) *N*-(2-hydroxybenzyl)chitosan.





る. Fig. 2-3(c)と同じ調製法で得られた電極は、ロットによる応答量の違いが 大きなもので約2倍ほどの開きがあったが、同じ電極を用いる限りは、10回の 濃縮/測定/再生の繰り返しで±4%以下であり、30日間100回測定後も初め の90%の酸化ピークを保った.

# 2.1.5.3 金属イオンの測定

HBC電極を1.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup>の銅イオンおよび鉛イオンに60分間浸漬した 場合のサイクリックボルタモグラムをFig.2-4に示す.銅イオンで+0.04V, 鉛イオンで-0.45Vに酸化ピークを示し,それぞれの電荷量は132μCおよび 273μCで,鉛イオンに対して銅イオンの約2倍高い濃縮選択性を示した.

Fig. 2-5 は1.0x10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup>の銅イオンに対する浸漬時間と応答量の関係 である. 180分浸漬後も応答の増加が見られた. 一方, 鉛イオンに対する応答 と浸漬時間の関係をFig. 2-6 に示した. 銅イオンよりも感度が高く, また低濃 度試料では銅イオンの場合と同じく, 200分浸漬後も応答量が平衡に達してい ないことが分かる. このことは検液中の金属イオン濃度が非常に低い場合でも 長時間電極を試料に浸漬することで, 十分定量可能なほどの濃度に濃縮できる ことを示唆する. 事実, 120分浸漬した場合, 1x10<sup>-7</sup> mol dm<sup>-3</sup>の低濃度域で の銅イオンと鉛イオンを定量することが出来た, Fig. 2-7 はその濃度域の検量 線である.

次に、銅イオンと鉛イオンが共存している場合について検討した. Fig. 2-4 に示したように、単一のイオン存在下では鉛イオンに対して高い感度を示した が、銅、鉛イオン共存下でのCV測定ではFig. 2-8のようなボルタモグラムが 得られ、銅イオンに対して鉛イオンより2.9倍高い感度を示した. これは、*N*-サリチリデングリシンを配位子とする錯体の場合<sup>24, 25)</sup>と同様、鉛イオンより も銅イオンの方がより安定な錯体を形成し、優先的に膜中に取り込まれるため と考えられる. 単一のイオン存在下での銅イオンへのより低い応答は、強く配 位した銅イオンが膜の収縮を引き起こし、膜中への物質移動を起こりにくくし ているためと推測される.

銅,鉛イオンそれぞれの応答が片方のイオン存在下でどのような影響を受けるかを示したのがFig. 2-9である.目的とするイオンを1.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup>に



Fig. 2-4 Cyclic voltammetric I-E curves after soaking in (a) 1.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup> Cu<sup>2+</sup> and (b) 1.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup> Pb<sup>2+</sup> solutions. Scan rate, 100 mV s<sup>-1</sup>; soaking time, 60 min; electrolyte, 0.05 mol dm<sup>-3</sup> KNO<sub>3</sub>. Dashed lines represent the curves before soaking.



Fig. 2-5 Effect of soaking time on the anodic peak charge of 1.0x10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup> Cu<sup>2+</sup>. Other conditions are as in Fig. 2-4.



Fig. 2-6 Effect of soaking time on the anodic peak charge of Pb<sup>2+</sup>. Numerical values beside the curves represent molar concentrations of Pb<sup>2+</sup>. Other conditions are as in Fig. 2-4.











Fig. 2-9 Anodic-peak charge changes for  $1.0 \times 10^{-5}$  mol dm<sup>-3</sup> Pb<sup>2+</sup> by the addition of Cu<sup>2+</sup> (O) and for  $1.0 \times 10^{-5}$  mol dm<sup>-3</sup> Cu<sup>2+</sup> by the addition of Pb<sup>2+</sup> ( $\Delta$ ). The left edge of the abscissa implies the absence of the coexisting divalent cation. Other conditions are as in Fig. 2-8.



Fig. 2-10 Anodic-peak charge changes for 1.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup> Pb<sup>2+</sup> by the addition of Na<sup>+</sup> (Δ) and Ca<sup>2+</sup> (▲) and for1.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup> Cu<sup>2+</sup> by the addition of Na<sup>+</sup> (O) and Ca<sup>2+</sup> (●). The left edge of the abscissa implies the absence of the coexisting cation. Other conditions are as in Fig. 2-8.

固定して,片方を百分の一(1.0 x 10<sup>-7</sup> mol dm<sup>-3</sup>)から5倍あるいは10倍の濃 度まで共存させたときの応答の変化として示した.鉛イオンの応答量は銅イオ ン不在下では高い応答を示したが,少量の銅イオン存在で影響を受けており5 倍モルの銅イオン存在下ではほとんど応答を示さなくなった.一方,銅イオン は応答量は低いが,同濃度の鉛存在下でもほとんど影響を受けていない結果が 得られた.

さらに、ナトリウム、カルシウムイオンの影響をFig. 2-10に示す. 鉛、銅 イオンとも、1000倍量のナトリウムイオン存在下でも全く影響を受けなかっ たが、カルシウムイオンは鉛、銅イオンへの応答いずれにも影響を及ぼし、10 倍の共存量で不在下の場合に比較して、鉛イオンで30%、銅イオンで20%の 応答の減少を引き起こした.

この修飾電極を用いて、カドミウム、ウラニル、コバルト、ニッケルの各イ オンの測定を試みた.4種類のいずれのイオンに対しても $1.0x10^{-5}$  mol dm<sup>-3</sup> の溶液に60分浸漬した結果では、全く応答が見られなかった。そこで、濃度を $<math>1.0x10^{-2}$  mol dm<sup>-3</sup>にした結果、 $60分浸漬後、カドミウムで-0.67V に 64.1 \mu$ C、ウラニルイオンで $-0.07V (c 15.3 \mu C m)$  の酸化ピークが見られた。これらの 値は、千分の一( $1.0x10^{-5}$  mol dm<sup>-3</sup>)の濃度の鉛イオンに60分浸漬したときの応答量 $233.5 \mu$ Cの27%および6.5%しかなく、この電極は鉛および銅イオン に対して高い選択性を有することが分かった。

## 2.2 ピリドキサール 類似体で修飾したキトサンを感応部とする光ファ

### イバ蛍光センサを用いた亜鉛イオンの定量

本節では、キトサンとピリドキサール類似体、FHMPから形成したシッフ 塩基を応答部位にもつ亜鉛定量用の光ファイバ蛍光センサについて述べる.

#### 2.2.1 試薬および装置

塩酸ピリドキシンは和光試薬特級をそのまま用いた. ピリジンはBaO存在下 蒸留した. DMF, DMSOはCaH<sub>2</sub>で乾燥後減圧蒸留した. DCCとブロモ酢酸は 減圧蒸留して用いた.キトサンは加ト吉製の95%脱アセチル化したものを,ア ガロースはドータイト電気泳動用(アガロースI)を,またN-カルボベンジロ キシー4-アミノブタン酸(N-CBZ-4-ABA)は東京化成より購入したものをそのまま用いた.水は逆浸透膜(ミリポア,Milli RO15)を通過させ精製後ヤマト科学製オートスチルWA-550でイオン交換したものを用いた.亜鉛イオンの母液はキシダ化学の過塩素酸亜鉛から調製した.その他の試薬は、いずれも特級品をそのまま用いた.

IRスペクトルは日立製270-50型赤外分光光度計を,紫外可視吸収スペクトルおよび蛍光スペクトルは日本分光UVIDEC-610A型分光光度計と島津RF-510型蛍光分光光度計をそれぞれ用いて測定した.NMRは日立製R-24B核磁気共鳴装置(60 MHz)を使用して測定した.

光ファイバセンサ計測システムはFig. 2-11に示すように、ウシオ製USH-500D型超高圧水銀灯を光源とし、NF製 CH-353型チョッパーで変調した後、 東芝製UV-D36Aフィルタと島津-ボシュロム製モノクロメーター(1350本 /mm)で365 nmの励起光を取り出した.これを二股型石英製光ファイバ(昭 和電線電纜SF-S400/500;直径0.5mm)の一端から導入し、直径1mmの同社 製光ファイバSF-S800/1000の先端に取り付けた感応部を照射した.感応部か らの蛍光はもう一方の光ファイバを用いて東芝製UV-Y39フィルターを通過し た後浜松ホトニクス製R105光電子増倍管で検出し、NF製5600Aロックインア ンプを通して信号を記録計に取り出した.

# 2.2.2 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-2-メチルピ

#### リジンによるキトサンの修飾

まず,Scheme 2-3<sup>26)</sup>に従って塩酸ピリドキシンの3位のヒドロキシル基 と4位のヒドロキシルメチル基の保護を行った後,5位ヒドロキシメチル基を 酸化した.その後,加水分解による脱保護基を行ってFHMPを合成した.次 に,Scheme 2-4に従って,キトサンのアミノ基とN-CBZ-4-ABAを縮合し側 鎖をのばした後,加水分解さらにブロモアセチル誘導体を合成した.その後, FHMPとの反応によりFHMP修飾キトサン(FHMP-C)を合成した.



Fig. 2-11 Schematic diagram of the fiber-optic sensing system. A, Hg lamp; B, light chopper ; C, glass filter; D, monochromator; E, fiber positioner; F, optical fiber; G, sample cell; H, glass filter; I, photomultiplier; J, lock-in amplifier; K, recorder.





2.2.2.1 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-2-メチル

## ピリジンの合成

塩酸ピリドキシン10.0gを アセトン150ml中に加え 500ml丸底フラスコに入れ た.これを,氷水で20分間冷 却した後,懸濁状態のまま右 図の装置を用いて,HClガス を激しく50分間通気すると溶 液は淡黄色に変化した.次



に、HClの通気を止めて反応容器を密栓した後、室温で75分間振とうして反応 を完了した.反応液をそのまま一昼夜冷蔵保存後、冷却したままエーテル 50mlを加えると白色結晶が析出した.これを濾別しエーテルで洗浄して白色 結晶((3,3,5-trimethyl-6-aza-4-oxaisochroman-8-yl)methan-1-ol hydrochloride( $\alpha^4$ ,3-O-isopropyridene pyridoxol hydrochloride; iso-PPOL・HCl) 収量:10.4g,収率:87%)を得た.この結晶10gを水50mlに 溶解し、1 mol dm<sup>-3</sup>NaOH水溶液約43mlで中和すると結晶が析出した.これ を水20ml で4回洗浄し乾燥した(iso-PPOL;収量:8.31g).

200ml丸底フラスコに乾燥ピリジン20mlを入れ、これにCrO31.36gを少量





ずつ約40分間かけて添加溶解した.その間ピリジン溶液は20℃以下に保ち, スターラーで激しく撹拌した.これに,上記の中和後の結晶を2g含むピリジ ン溶液を加えて,約2時間かけてゆっくりとリフラックス温度まで上げた.さ らに,2時間加熱環流した後,冷却し,冷水40mlを加え,エーテル100mlで 5回抽出した.エーテル相を水500mlで洗浄後,無水硫酸ナトリウムで乾燥し た.エーテルをエバポレーターで除くとタール状の物質が得られた.これを昇 華して淡黄色結晶を得た(3,3,5-trimethyl-6-aza-4-oxaisochromane-8carboaldehyde(α4,3-O-isopropyridene pyridoxal; iso-PPAL)収量:598 mg,収率:30%).この結晶400mgを0.1moldm<sup>-3</sup>の塩酸20mlに溶解し,ス チームバス上で1時間加熱した.その後エバポレーターを用い,50℃に加熱し た状態で水を除き,減圧乾燥させると淡黄色のFHMPの塩酸塩(FHMP・HCl )が得られた(収量:375mg,収率:95%).

# 2.2.2.2 キトサンのブロモアセチル誘導体の合成

# (a) N-CBZ-4-アミノブチリルキトサンの合成

キトサン300mg (アミノ基換算モル数1.86mmol) を2%酢酸水溶液50ml に溶解後1mol dm<sup>-3</sup>のNaOHでゲルを析出させた.この膨潤したゲルを水 40mlで3回,続いてDMF20ml で2回洗浄した.次にDMF6mlを加え24時間 撹拌後, *N*-CBZ-4-ABA 2.21g (9.32 mmol) を含むDMF6mlを加えて40℃で24時間撹拌すると白色沈 限と淡黄色のゲルが生じた.メタノール40ml で6回洗浄すると白色沈殿が除 かれ,淡黄色ゲルが残った.遠心分離後,減圧乾燥し*N*-CBZ-4-アミノブチリ ルキトサン (*N*-CBZ-ABC; 収量:537mg) を得た.

# (b) CBZ 基の酸加水分解による除去

N-CBZ-ABC 199mg に酢酸1.5mlを加え25℃で2時間撹拌後,6mol dm-3 HBr 1.3mlを加えてさらに15時間30℃で撹拌した.微量の不溶物を遠心分離で 除去後アセトン20mlを添加するとゲル(4-アミノブチリルキトサン,4-ABC) が析出した.これをアセトン20mlで3回洗浄した.

# (c) ブロモアセチル化

得られた4-ABCゲルを水0.7mlに溶解した. これに0.1mol dm-3のNaOH約

7 mlを加えてpH8.5にした. これに DMF 2 mlを加えた(A 液). 一方, N-ヒ ドロキシスクシンイミド1.83g(15.9mmol)を含むジオキサン溶液20mlとブ ロモ酢酸1.82g(13.1 mmol)を含むジオキサン10mlおよびDCC3.0g(14.5 mmol)を含むジオキサン溶液10mlを混合し,60分撹拌した.生じた白色沈殿 をフィルター(G-4)でろ過して得られた活性エステル溶液を先のA 液に加 え,4℃で24時間撹拌した.析出ゲルをジオキサン20mlで2回洗浄してブロ モアセチル-4-ABC(BrABC)を得た.

# 2.2.2.3 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-2-メチル

ピリジンでの修飾

BrABCにDMSO 1mlを加え撹拌し, 膨潤懸濁状態とした. これに先に合成 したFHMP・HCl 164mg(0.81 mmol)を含むDMSO 2 mlを加え50℃, 24時 間遮光状態で撹拌した. その後ゲルが完全には溶解していなかったので, 遠心 分離し, 下層固体(収量110mg)と上澄みに分けた. 上澄みにアセトン約 35mlを加えるとゲルが析出した. 遠心分離後アセトン20mlで 2 回洗浄し FHMP修飾キトサン(FHMP-C; 収量: 51.6mg)を得た.

# 2.2.3 プローブの作製と蛍光測定

Fig. 2-12のように外径1mmの光ファ イバと,外径0.5mmの光ファイバ2本 をテフロンチューブで接続し,その外側 をステンレスチューブで保護した.外径 1mmの光ファイバの先端部にはガラス 管(1mm i.d. x 0.5 mm)を熱収縮 チューブで固定した.

アガロース15mgを水0.5mlに加熱溶 解した.これにFHMP-C2mgを溶解し た水0.2mlを添加し,60℃に保った.こ の溶液にFig.2-12に示した光ファイバ





先端部を浸漬,直ちに引き上げ冷却固化させた.このFHMP-C/アガロース

膜の厚さは約0.5mmであった.

作製したセンサプローブを、10mlの検液を入れたバッチ型セルにセットし (Fig. 2-11),マイクロシリンジで順次金属イオンを添加していく方法でセ ンサの応答を見た.また、センサプローブを再生するときは0.01mol dm<sup>-3</sup> EDTA溶液に3分、続いて水に10分間浸漬した.

## 2.2.4 結果と考察

### 2.2.4.1 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-2-メチル

ピリジンの同定

塩酸ピリドキシンとアセトンの反応から得られた化合物の<sup>1</sup>H NMRスペクト ル (Fig. 2–13) は、高磁場側より $\delta$ =1.71(6H, s, –(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)、2.68(3H, s, Ar– CH<sub>3</sub>)、4.74(2H, s, Ar–<u>CH<sub>2</sub></u>–OH)、5.20(2H, s, Ar–<u>CH<sub>2</sub></u>–O–)、8.21(1H, s, Ar–H)と帰属される.また、5'–ヒドロキシルメチル基のメチレンプロトンは  $\delta$ =4.74のHDOシグナルに重なっていることがFig. 2–14との比較で示唆され た.融点は209~213℃(文献値209~211℃)<sup>26)</sup>であった.以上より、ピリ ドキシンの3位ヒドロキシル基と4'位ヒドロキシル基間で環状のケタールを形 成しているiso–PPOL・HCIの生成を確認した.

iso-PPOL・HClを中和して得られた化合物の<sup>1</sup>H NMRスペクトル (Fig. 2-14)は、高磁場側よりδ=1.59(6H, s, -(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)、2.39(3H, s, Ar-CH<sub>3</sub>)、4.51 (2H, s, Ar-<u>CH</u><sub>2</sub>-OH)、4.91(2H, s, Ar-<u>CH</u><sub>2</sub>-O-)、7.75(1H, s, Ar-H)と帰属さ れ、ピリジン窒素の脱プロトン化による電子吸引性減少の結果として、全シグ ナルの高磁場シフトが見られた.融点は103~106℃であった. IR スペクトル (Fig. 2-15, KBr法)は、1146cm<sup>-1</sup>(C-O-C)、1380cm<sup>-1</sup>(CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)、 1612cm<sup>-1</sup>(ピリジン骨格)に吸収を示した.以上よりiso-PPOLの生成を確認し た.

iso-PPOLをクロム酸酸化して得られた化合物の<sup>1</sup>H NMRスペクトル (Fig. 2-16)は、高磁場側より δ=1.50(6H, s, -(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)、2.45(3H, s, Ar-CH<sub>3</sub>)、5.12(2H, s, Ar-<u>CH<sub>2</sub></u>-OH)、4.91(2H, s, Ar-<u>CH<sub>2</sub></u>-O-)、8.43(1H, s, Ar-H)および、新たに出現した10.02(1H, s, Ar-CHO)と帰属された.融点は52~61℃(文献値59~60℃)<sup>26)</sup>であった. IR スペクトル (Fig. 2-17, KBr法)は、







Fig. 2-14 60 MHz <sup>1</sup>H NMR spectrum of iso-PPOL in CDCl<sub>3</sub>. The chemical shift was calibrated by TMS.













OH基に由来する3500cm<sup>-1</sup>付近のブロードな吸収の減少,および新たに 1706cm<sup>-1</sup>にCHOカルボニルの強い吸収が出現した.以上より, iso-PPALの 生成を確認した.

最後にiso-PPALの塩酸加水分解で得られた化合物の<sup>1</sup>H NMRスペクトル( Fig. 2-18)は、高磁場側よりδ=2.65(3H, s, Ar-CH<sub>3</sub>)、5.32(2H, s, Ar-<u>CH</u><sub>2</sub>-OH)、6.71(2H, s, CH)、8.31(1H, s, Ar-H)と帰属され、δ=1.50付近のイソ プロピル基のメチルシグナルの消失が観測された.また、δ=10付近のフォル ミルプロトンの消失とδ=6.71のメチンシグナルの出現は、重水中で4'位のヒ ドロキシル基と5位フォルミル基でヘミアセタールを形成してると考えられ る.融点は300℃以上であった. IR スペクトル(Fig. 2-19, KBr法)は、3000 ~3500cm<sup>-1</sup>付近のブロードなOH基の再出現、および1706cm<sup>-1</sup>のCHOカルボ ニルの吸収消失を示した.このことは、<sup>1</sup>H NMRで予想されたように、 FHMP- HCl が分子内でヘミアセタールを形成していることを支持する.以上 より、目的物の生成を確認した.

#### 2.2.4.2 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-2-メチル

#### ピリジンによるキトサンの修飾

Scheme 2-4に従ってキトサンに側鎖を導入する場合,各段階の中間生成物 は主にIRを用いて検討した.

キトサンを*N*-CBZ-4-ABAとDCCで処理して得られたゲルはFig. 2-20(b)の IRスペクトルを与えた. 1670cm<sup>-1</sup>と1545cm<sup>-1</sup>にそれぞれアミドIとアミドIIの 吸収帯が見られた. また, 2940cm<sup>-1</sup>付近にメチレンの吸収増加と1720~1740 cm<sup>-1</sup>付近にベンジルオキシカルボニルのC=O伸縮振動が大きく見られた. こ れより, *N*-CBZ-4-ABAがキトサン骨格に導入された, *N*-CBZ-4-ABCが生成 していると考えた.

N-CBZ-4-ABCを脱CBZ処理して得られた4-ABCのIRスペクトル(Fig. 2-21(a))はアミドIとアミドIIの吸収帯が1660cm<sup>-1</sup>と1550cm<sup>-1</sup>付近に残ってい るが、ベンジルオキシカルボニルのC=O伸縮振動に由来する1740cm<sup>-1</sup>の吸収 が大きく減少した.このことは脱CBZが起こっていることを示す.

次に、ブロモアセチル化後のIRスペクトル (Fig. 2-21(b)) は1660cm-1と















Fig. 2-21 IR spectra of (a) 4-ABC and (b) BrABC.

1550cm<sup>-1</sup>の吸収に重なって1630cm<sup>-1</sup>と1580cm<sup>-1</sup>に新たなアミドIおよびアミ ドIIの吸収が見られた.また,640cm<sup>-1</sup>にはC-Brの伸縮振動も出現した.これ らのことから,ブロモアセチル化が進行したものと判断した.

BrABCにFHMPを反応させて得られたゲル(FHMP-C)の<sup>1</sup>H NMRスペクトル(Fig. 2-22)は、高分子の試料を60MHzの装置で測定しているため十分

な解析を期待できないが、δ=2.65 (3H, s, -CH<sub>3</sub>), 4.10 (2H, s, =N<sup>+</sup>-<u>CH</u><sub>2</sub>CONH-), 5.24 (2H, s, -<u>CH</u><sub>2</sub>OH), 7.38 (1H, s, -CH=N-), 8.43 (1H, s, Ar-H)に構造から予想されるシ グナルが見られた. ここで、δ=7.38のシグナ ルは原料のFHMPに見られないシグナルであ り、キトサンのアミノ基とシッフ塩基を形成 したイミンプロトンに帰属できる. IRスペク トル (Fig. 2-23) は、1664cm<sup>-1</sup>と1552cm<sup>-1</sup> のアミドI, IIの吸収および1645cm<sup>-1</sup>に-C=N-と思われる吸収を示し、これもシッフ 塩基の存在を示唆した. これらのことから本 修飾体は右図のような構造を有しているもの と思われる.



# 2.2.4.3 5-ホルミル-3-ヒドロキシ-4-ヒドロキシメチル-2-メチル

ピリジン修飾キトサンの紫外可視および蛍光スペクトル

FHMP-Cを0.01 mol dm<sup>-3</sup> HCl/MeOHに溶解してシッフ塩基を加水分解し て得られた紫外可視吸収スペクトルはFHMPの場合と同様294nmに吸収極大 を示した.また,0.01 mol dm<sup>-3</sup> NaOH/MeOH中では333nm,256nm, 230nmの吸収極大を示した.0.01 mol dm<sup>-3</sup> HCl/MeOH中での吸光度の比較 よりグルコサミン約7ユニットあたり1個のFHMPが置換されていることが計 算された.

FHMP-Cのメタノール溶液に亜鉛イオンを添加したときの蛍光スペクトルの変化をFig. 2-24に示す.励起波長365nmで410nm付近の蛍光が見られ、そ



Fig. 2-22 60 MHz <sup>1</sup>H NMR spectrum of FHMP-C in DMSO-d<sub>6</sub>. The chemical shift was calibrated by TMS.



Fig. 2-23 IR spectrum of FHMP-C.









の強度は亜鉛イオン濃度の増加にしたがって増加した.この蛍光は水/MeOH 混合液では低下し,また酸([HClO<sub>4</sub>]=1.0x10<sup>-3</sup> mol dm<sup>-3</sup>/MeOH) やアルカ リ([KOH]=1.0x10<sup>-3</sup> mol dm<sup>-3</sup>/MeOH) 存在下でも大きく減少した.これら は、シッフ塩基の加水分解による蛍光減少を示唆し、蛍光発光がシッフ塩基亜 鉛キレートの生成に起因していることを示す.蛍光性の錯体はおそらく、前田 らの報告<sup>20)</sup>によるピリドキサール/グルコサミン/亜鉛キレート錯体の構造(下 図 a) に類似した構造(下図 b) を有しているものと思われる.



(b) Zn(II) chelate of FHMP-C

この亜鉛イオンによる蛍光強度増加の現象を利用して,以下に述べるような亜 鉛イオン光ファイバセンサの構築を試みた.

#### 2.2.4.4 センサの応答特性

FHMP-Cを二股型光ファイバ先端に固定する場合,FHMP-C自身を風乾製 膜しただけでは検液への溶解のため耐久性が悪かった.そこで2.2.3項で述べ たようにアガロースゲルと混合して固定化した.Fig. 2-25に5.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup>の亜鉛イオンに対する80%メタノール中での繰り返し応答図を示す.セ ンサはバッチ型セル中の10mlの検液に浸し亜鉛イオンを添加すると約15分で ー定値を示した.次に 0.1mol dm<sup>-3</sup>のEDTA水溶液を1ml添加すると蛍光強度 は1分以内に消失した.ピリドキサールおよび芳香族アルデヒドとアミノ糖や アミノ酸シッフ塩基は亜鉛キレートを形成すると強い蛍光を発することが知ら れており、蛍光の消失はEDTAによる亜鉛イオンの捕捉がシッフ塩基キレート の解離を引き起こしていることを示唆する.繰り返し使用する場合,EDTA処 理したセンサプローブを別容器に入れた水中に10分浸漬洗浄後,次のサンプル は検液を入れ替えて再度測定を行った.8回繰り返し再現誤差は5%以内であ り1週間を通して40回測定後も初めの90%の応答を示した.このことは、 FHMP-Cがアガロースマトリックス中に、おそらく多点での水素結合で安定 に固定されていることを示している.

応答は検液の水の割合が増加すると大きく減少し(Fig. 2-26), この挙動 は均一溶液中の蛍光スペクトル測定時の結果と同様であった.シッフ塩基の加 水分解が蛍光性キレート錯体の分解を引き起こしたことが原因であろう.

センサは他の金属イオン,特にカドミウムイオンとガリウムイオンに対して も応答を示した(Fig. 2-27).この場合Fig. 2-25の亜鉛イオンの応答速度よ りもかなり速い応答を示しているが,これと同じセンサを用いた1.0x10<sup>-3</sup> mol dm<sup>-3</sup>の亜鉛に対する応答速度もほぼ同じく1分以内であったので,この場合 膜厚が薄く調製されているものと思われ,応答速度はプローブの膜厚と試料の 濃度に依存することを示唆する.

これら3種類のイオンに対する検量線をFig. 2-28に示す. 亜鉛イオンに対 して高い応答選択性を示し、0~2.0x10<sup>-5</sup> mol dm-3の検量線は相関係数 0.994の直線を示した. また、検出下限はS/N=3の時1.0x10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup>で あった. アルミニウムイオンに対する応答はガリウムイオンの約半分であった が、マグネシウムイオンはそのシッフ塩基キレート錯体の生成定数が低い<sup>25)</sup> ため、ほとんど応答を示さなかった. 銅、ニッケルイオンに対しては全く応答 を示さなかったが、これはおそらく、配位子内π-π\*励起1重項状態のエネル ギーが、d-d励起状態か電荷移動励起状態へ無放射失活<sup>27)</sup> するためと考えら れる.

ピリドキサールとアミノ糖のシッフ塩基の亜鉛キレートが高い蛍光性を示す には、アミノ基に隣接したヒドロキシル基が重要な役割を果たしていることが



Fig. 2-26 Effect of the water content on the response. The concentration of  $Zn^{2+}$  was the same as that in Fig. 2-25.



Fig. 2-27 Typical responses of the sensor upon successive introduction of (a)  $Cd^{2+}$  and (b)  $Ga^{3+}$  into the batch cell. One hundred  $\mu l$  of each 0.1 mol dm<sup>-3</sup> metal ion was added to 10 ml of 80% aqueous MeOH.







指摘されている<sup>20)</sup>. このことから, FHMP-C のキトサン骨格のヒドロキシル 基もキレート形成に関与して亜鉛キレートの発蛍光に重要な役割を果たしてい ることが予想される. ここでは示していないが, FHMP-C亜鉛キレートは FHMPとバリンで生成したシッフ塩基の亜鉛キレートよりも約4倍強い蛍光を 示した. このこともキトサン骨格のヒドロキシル基の関与を裏付けている.

#### 2.3 総括

本章では、キトサン誘導体を感応部に用いた2種類のタイプの金属イオンセンサについて検討した.

ヒドロキシベンジル基を導入したキトサンで修飾したグラッシーカーボン電 極は、水溶液中のカドミウム、ウラニル、コバルト、ニッケルの各イオンに対 してほとんど応答を示さなかったが、鉛と銅イオンに対して高い応答選択性を 示し、両金属イオンとも1.0x10<sup>-7</sup> mol dm<sup>-3</sup>での定量が可能であった. 応答再 現性は10回の連続測定で±4%以下と良好であった. 単一イオン存在下では鉛 イオンに対する応答が高いが、銅・鉛イオン共存下では鉛イオンの応答の減少 が見られ、銅イオンに対する応答は影響を受けにくかった. これらの挙動は、 銅イオンの高い錯形成能で説明できた.

一方,ピリドキサール誘導体で修飾したキトサン(FHMP-C)は,亜鉛イオン存在下で強い蛍光を発することを見いだした.FHMP-Cを光ファイバ先端にアガロースとともに固定した二股型光ファイバ蛍光センサは,亜鉛イオンに対して,5.0x10<sup>-5</sup> mol dm<sup>-3</sup>の亜鉛イオンに対し1週間を通して40回測定後も初めの90%の応答を示し,繰り返し再現性のある応答を与えることが分かった.また,80%MeOH溶媒中で検出下限は1.0x10<sup>-6</sup> mol dm<sup>-3</sup>(S/N=3)であり,FHMP-Cが亜鉛イオンの光ファイバ蛍光分析に利用できることが分かった.

以上のように、キトサンは化学修飾により、特定の金属イオンセンサの応答 部位の材料として利用できる適切な性質を有していることが分かった.その性 質を簡単にまとめると(1)グルコサミンの重合体のため、アミノ基をユニッ ト毎に有し、高度に置換した修飾体が得られる.このことは、高濃縮・高感度 化に寄与する.(2)その際、反応性の高いアミノ基を利用するため、配位子 部位の分子設計が比較的容易にできる.(3)キトサン骨格のヒドロキシル基 の存在が錯体形成に有利に利用できる(4)得られた修飾体は適当な溶媒に溶 解した後それ自身でキャスト膜とするか,あるいは他のマトリックスと混合し て安定に固定化できるためセンサ応答部位を構築しやすいことなどが挙げられ る.

#### 参考文献

- 1) R. A. A. Muzzarelli, O. Tubertini : Talanta, 16, 1571 (1969).
- 2) L. D. Hall, M. Yalpani : Carbohydr. Res., 83, C5 (1980).
- 3) 井上勝利, 大渡啓介, 吉塚和治, 新原隆司, 喜納兼勇:分析化学( Bunseki Kagaku), 44, 283 (1995).
- K. Inoue, K.Ohto, K. Yosizuka, T. Yamaguchi : T. Tanaka, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **70**, 2443 (1997).
- 5) K. Ohga, Y.Kurauchi, H. Yanase : Bull. Chem. Soc. Jpn., 60, 444 (1987).
- 6) S. V. Prabhu, R. P. Baldwin : Anal. Chem., 59, 1074 (1987).
- 7) S. -Z. Yao, X. -M. Chen, L. -H. Nie : Mikrochim. Acta, 1, 299 (1990).
- 8) L. A. Saari, W. R. Seitz : Anal. chem., 55, 667 (1983).
- 9) O. Egorov, J. Ruzicka : Analyst, 120, 1959 (1995).
- 10) W. H. Chan, A. W. M. Lee, C. M. Lee, K. W. Yau, K. Wang : Analyst, 120, 1963 (1995).
- W. H. Chan, A. W. M. Lee, D. W. J. Kwong, W. L. Tam, K-M. Wang : Analyst, 121, 531 (1996).
- 12) J. E. Madden, T. J. Cardwell, R. W. Cattrall, L. W. Deady : Anal. Chim. Acta.,
  319, 129 (1996).
- 13) I. Murkovic, I. Oehme, G. J. Mohr, T. Ferber, O. S. Wolfbeis : *Mikrochim. Acta*, 121, 249 (1995).
- 14) 渡辺邦洋, 青木伊豆男:分析化学(Bunseki Kagaku), 35, 1 (1986).
- 15) 渡辺邦洋, 青木伊豆男:分析化学(Bunseki Kagaku), 35, 487 (1986).
- 16) R. M. Dagnall, R. Smith, T. S. West : Talanta, 13, 609 (1966).
- 17) R. M. Dagnall, R. Smith, T. S. West : Analyst, 92, 20 (1967).

- 18) F. Capitan, A. Navalon, J. L. Vilchez : Anal. Lett., 23, 1907 (1990).
- 19) 渡辺邦洋, 青木伊豆男:分析化学(Bunseki Kagaku), 34, 497 (1985).
- 20) M.Maeda, T. Kinoshita, A Tsuji : Anal. Biochem., 38, 121 (1970).
- 21) R. B. Thompson, E. R. Jones : Anal. Chem., 65, 730 (1993).
- 22) S. Hirano, N. Matsuda, O. Miura, H. Iwaki : Carbohydr. Res., 71, 339 (1979).
- 23) L. B. Wingard, Jr., J. L. Gurecka, Jr. : J. Mol. Catal., 9, 209 (1980).
- 24) D. L. Leussing, K. S. Bai : Anal. Chem., 40, 575 (1968).
- 25) D. Hopgood, D. L. Leussing : J. Am. Chem. Soc., 91, 3740 (1969).
- 26) R. J. Johonson, D. E. Metzler : "Methods in Enzymology", ed. D. B.
  McCormick, L. D. Wright, Vol.18, Part A, p.527 (1970), (Academic Press, New York) ; W. Korytnyk, E. J. Kris, R. P. Singh : J. Org. Chem., 29, 574 (1964).
- 27) K. Ohga, Y. Kurauchi : Bull. Chem. Soc. Jpn., 60, 3269 (1987).

# 第3章 ピレン誘導体で修飾したキトサンを感応部とする 有機溶媒中微量水分測定用光ファイバ蛍光センサ

石油製品を含めた液状有機化合物中の不純物としての微量水分はその性質に 大きく影響を与える.これらの製品の製造プロセス管理には,水分のオンライ ン分析が必要になり,有機溶媒中の水分測定およびその自動化は大きな課題と なっている.

もっとも広く用いられている有機溶媒中の微量水分の定量は、カールフィッシャー滴定法<sup>1)</sup>であろう.この方法を自動化しようとする場合、回分法に比べて感度が落ちる欠点がある.そのため従来より知られている四酢酸鉛<sup>2)</sup>、クロマズロールB<sup>3)</sup>、ジチゾン<sup>4)</sup>などの発色試薬を用いた分光光度法による定量法をフローインジェクション分析(FA法)に応用し自動化を図った研究<sup>5)</sup>や検出部位にOH基に選択的な近赤外線を用いたFA法<sup>6)</sup>なども近年報告されている.また、さらに高い精度を必要とする場合の分析法として、従来よりガスクロマトグラフィーを用いた方法<sup>7,8,9)</sup>が行われている.これら以外にも、ピリジニウムフェノレートベタイン色素のソルバトクロミズムを利用した方法<sup>10)</sup>や*N,N*-カルボニルジイミダゾールとの反応で発生した炭酸ガス量で水分の測定を行う方法<sup>11)</sup>、ユーロピウム(III)の水和に起因する蛍光寿命の減少測定によるDMF、DMSO中の水分分析法<sup>12)</sup>など様々な方法が提唱されている.しかし、これらはいずれもサンプリングや反応に伴う分析手順の煩雑さのためリアルタイムな分析への利用が困難である欠点を有する.

一方,ナフィオン膜で覆われた電極を用いたパルス電解法<sup>13)</sup> は微量水分の オンライン分析への応用を目的として検討されている.また,我々は,近年 PVC液膜中に固定したピレンカルボキシアルデヒドの蛍光強度が少量の水に よって変化することを利用して,リアルタイムなエタノール中の水分測定用光 ファイバセンサ<sup>14)</sup> を作製しその特性について報告した.しかし,PVC液膜へ の水分取り込み量の制限やピレン誘導体の漏出などの問題があり,センサとし て十分な性能を有していなかった.

本章ではキトサン骨格にピレンカルボキシアルデヒド部位を共有結合で導入 した修飾体の合成と、有機溶媒中のリアルタイムな水分定量用光ファイバセン サの作製手順および応答特性について述べる. 感応部膜材料としてキトサンを 用いたのは,水に対する高い濃縮効果を期待したためである. この水への高い 親和性は,キトサン膜およびその架橋膜の水に対する選択的透過を可能にし, この性質を利用して,バイオ発酵で得られる低濃度のエタノールの分離濃縮膜 への利用<sup>15,16)</sup> も試みられている. 一方,疎水的または親水的なミクロ環境が ピレン類の蛍光強度の増減をもたらすことが期待され,この現象をセンサに応 用しようとするものである. さらに,ピレンカルボキシアルデヒドをキトサン 膜に導入した場合,キトサンの残存アミノ基とシッフ塩基を形成することが予 想され,水の存在によって引き起こされるであろう可逆的なシッフ塩基の解離 平衡による蛍光強度変化が加わり,より高感度のセンサが期待される.

#### 3.1 実験

#### 3.1.1 試薬および装置

キトサンは加ト吉製の95%脱アセチル化したものをそのまま用いた.1-ピ レンブタン酸(1-PBA), N-メチルフォルムアニリドはアルドリッチ社よ り、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシランは信越化学より、また1-エチ ル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド(WSC)は同仁化学研究 所から購入した.O-ジクロロベンゼンは和光化学用を金属ナトリウム存在 下、またDMFとDMSOは和光特級品を水素化カルシウム存在下いずれもアル ゴン雰囲気中で減圧蒸留した.測定溶媒に用いた乾燥エタノールは水素化カル シウム存在下、アセトニトリルは五酸化ニリン存在下3時間還流後にそれぞれ 単蒸留し乾燥精製した.ベンゼンとヘキサンは、金属ナトリウム存在下単蒸留 した.ケロシンは活性化モレキュラシーブで処理して乾燥した.その他の試薬 は全て市販特級品を使用した.水はミリポア製逆浸透純粋製造装置Milli-RO15 とヤマト製イオン交換装置WA-550を通したものを用いた.IRスペクトルは日 立製270-50型赤外分光光時計で得た、紫外可視吸収スペクトルは島津製UV-160型分光光度計を、NMRはブルカー製ARX 300を用いて測定した.

石英製光ファイバは第2章2.2.1と同じものを用いた,二股型光ファイバ蛍 光測定装置は第2章のFig. 2-11と同様な構成部分で成り立っている.ただ し,励起光側フィルターには東芝製ガラスフィルターKLA3を,受光側には同 社製フィルターY47を用いた.また,光電子増倍管は浜松製C665を用いた. 超高圧水銀灯を光源とした励起光はライトチョッパーにより交流に変調後, フィルター,モノクロメーターを通して365nm光のみを,二股型光ファイ バーセンサの一端より導入しプローブ先端の応答膜中のピレン誘導体を励起し

た.プローブ先端はFig. 3-1 の回分式セル中に入れた10ml の有機溶媒中に浸漬し,一定 濃度の水を含む試料をシリン ジで順次注入添加した.セル の内部は測定対象とする有機 溶媒の蒸気を飽和させたアル ゴンガスを流し,大気中の水 分の影響を除いた.先端プ ローブからの蛍光は,もう一 方の光ファイバよりフィルタ を通して光電子増倍管で検 出,ロックインアンプで増幅 した.



Fig. 3-1 Construction of the cell and the probe.
A, incident light; B, Ar gas; C, flow of the thermostated water; D, 0.5 mm \u03c6 quartz fiber; E, fluorescence; F, sample injection; G, stainless tube; H, 1 mm \u03c6 quartz fiber; I, heat-shrinkable tube; J, CPFP/chitosan membrane;

# 3.1.2 1-カルボキシプロピルフォルミルピレンの合成

Scheme 3·1<sup>17)</sup> に従って合成した. 1-PBA1.2g(4.2 mmol), *N*-メチル フォルムアニリド2.0 ml(2.2g, 16 mmol), オキシ塩化リン4.0 ml(6.6 g , 43 mmol)を1,2-ジクロロベンゼン4 mlに混合溶解させ, アルゴン雰囲気 下, 90℃で5時間加熱反応させると黒褐色の液体が得られた. これを酢酸ナト リウム10 gを含む水溶液20 ml中に注ぎ,水相を除去後,さらに20 mlの水で有 機相の洗浄を2 回繰り返した. 得られた有機相にはトルエン15 mlを加えたあ と,12N塩酸6 mlを加え90℃3時間撹拌し加水分解すると濃緑黄色の固体が 析出した. これを濾別後クロロホルムで洗浄,乾燥した(収量625 mg). つづ いて真空ポンプ減圧下180℃の油浴加熱による昇華装置を用いた蒸留操作によ り黄色固体を得た(収量327 mg,収率18%). さらにクロロホルムで再結晶し



110 mg (収率8.3%, 融点173.0-177.0℃)の黄色結晶1-カルボキシプロピル フォルミルピレン (CPFP, 6-,8-異性体の混合物)を得た.

# 3.1.3 1-カルボキシプロピルフォルミルピレン修飾キトサン膜の調製

キトサン25.5mg(グルコサミンユニットに換算して0.15 mmol)を2%酢 酸水溶液0.5mlに溶解しテフロン板上にキャストして風乾製膜した.テフロン 板に貼り付けた状態で,1mol dm<sup>-3</sup>のNaOH水溶液,イオン交換水続いて DMFで十分洗浄した.一方,WSC 300mg(1.57 mmol)を含む66%DMF水 溶液1.5mlと,CPFP50.0mg(0.158 mmol)を含むDMF2mlを混合した溶液 をキトサン膜に加え室温48時間反応した後,膜を十分DMFで洗浄した.得ら れたCPFP修飾キトサン膜のIRスペクトルを測定した.

# 3.1.4 光ファイバへのキトサン膜の被覆と1-カルボキシプロピルフォ ルミルピレンによる修飾

1mm径の光ファイバを長さ30mmに切り、ナイロンコーティングをカッ ターナイフで除去した.次に、1200番エメリー紙とアルミナ研磨剤で鏡面研 磨した端面を2moldm<sup>-3</sup>塩酸中で90℃2時間活性化した後、水で十分洗浄 し、120℃で3時間減圧乾燥した.この端面を10v/v%の3-グリシドキシプ ロピルトリメトキシシランを含む乾燥ベンゼン20ml 中に入れ、アルゴン雰囲 気下85℃12時間反応させシラン化した.次に、このファイバロッドをScheme 3-2に従って、60mgのキトサンを含む2% 酢酸水溶液をNaOHでpH5.5に調 整した溶液4ml中で室温,24時間反応させー旦キトサンを共有結合して続い てコーティングするキトサン膜と電極表面の親和性を増加させた、続いて、こ のファイバに、浸漬引き上げ/風乾によるコーティングの操作を3回繰り返 し,キトサンを製膜した.得られたキトサン膜被覆ファイバを,1moldm-3 NaOH水溶液に1時間浸漬後,水洗浄し,WSC 60mg (0.31mmol)と CPFP10mg (0.031mmol) を含む66%DMF水溶液0.3ml中に入れ,室温で60 時間反応させた. その後40℃インキュベーター中で24時間乾燥して得られた ロッドをFig. 3-1のプローブ先端部の脱着可能な感応部位として用いた。測定 は、先述したように、アルゴン雰囲気下バッチ式容器中の10ml検液に、水分





### 3.2 結果と考察

# 3.2.1 1-カルボキシプロピルフォルミルピレンの同定

3.1.2項で得られた黄色結晶はシリカゲルTLC(展開溶媒:40%酢酸エチル /ヘキサン)で、原料の1-PBA(R<sub>f</sub>=0.23)と異なるR<sub>f</sub>値(R<sub>f</sub>=0.10)を与えた. IR (Fig. 3-2) スペクトルより、原料の1-PBAには1703cm<sup>-1</sup>にカルボキシル基 のC=O伸縮,1450cm<sup>-1</sup>にC-O伸縮,1282cm<sup>-1</sup>,1208cm<sup>-1</sup>にO-H面内変角振動 および854cm<sup>-1</sup>に芳香環のC-H面外変角振動が見られる.これに対し生成物に は1695cm<sup>-1</sup>に新たにアルデヒドのC=O伸縮が観測され、CPFPの生成を示唆 した.また、<sup>1</sup>H NMR (Fig. 3-4)より、新たに  $\delta$ 10.79にアルデヒドプロトン1 個分が見られたことからピレン環のフォルミル化を示唆した.アルキル鎖部位 は原料の1-PBA(Fig. 3-3)とほぼ同じ化学シフト値にシグナルを与えたが、 7位のメチレンdはHDOの大きなシグナルに重なっているものと思われる.

δ/ppm	Proton	Multiplici	ty J/Hz	Integral
12.1	СООН	broad	-	0.63
10.79	СНО	S	-	1.00
9.40	Ar-H 1	d	9.64	0.54
9.33	Ar-H ①'	d	9.31	0.47
8.67	Ar-H 2	d	9.64	0.55
8.61	Ar-H ③'	d	9.24	0.45
8.55	Ar-H (5),(5)'	d	7.96	0.94
8.42	Ar-H 6,6	d	8.06	)
8.40	Ar-H (2)'	d	8.86	1200
8.37	Ar-H⑦,⑦'	d	8.07	3.03
8.34	Ar-H ③	d	8.92	)
8.29	Ar-H ④'	d	9.24	0.44
8.20	Ar-H ④	d	8.92	0.58
8.03	Ar-H (8),(8)'	d	7.80	0.94
3.40	HDO/-CH <sub>2</sub> -(d)	-		
2.39	-CH <sub>2</sub> -(b)	t	7.23, 7.08	2.11
2.01	-CH <sub>2</sub> -(c)	q 7.0	8, 6.99, 6.99, 7.02	2.02

Table 3-1 Summary of <sup>1</sup>H NMR data of CPFP.



Wavenumber / cm<sup>-1</sup>

Fig. 3-2 IR spectra of (a) 1-PBA and (b) CPFP.



Fig. 3-3 400 MHz <sup>1</sup>H NMR spectra of 1-PBA in pyridine-d<sub>5</sub>: (a) entire spectrum; (b) partial spectrum.  $\alpha$ ,  $\beta$  and  $\gamma$  represent the signals of aromatic protons of pyridine. The chemical shift was calibrated by TMS.



Fig. 3-4 400 MHz <sup>1</sup>H NMR spectrum of CPFP in DMSO-d<sub>6</sub>. The chemical shift was calibrated by TMS.





一方,芳香環プロトンは1-PBAと大きく異なり,それぞれ一対のシグナルを与 えていることが分かる.詳細な解析のため,この部分を拡大したH-H COSYス ペクトルをFig. 3-5に示した.全てのシグナルがダブレットで現れており,シ ングレットのシグナルが見られていないことから,6位または8位以外への フォルミル基の導入は起こっていないことが推定された.それぞれの相関から Fig. 3-5のように帰属され,2種類のCPFPすなわち,1-カルボキシプロピ ル-6-フォルミルピレン(1-CP-6-FP)および1-カルボキシプロピル-8-フォルミルピレン(1-CP-8-FP)の2つの異性体の混合物であることが明ら かになった.フォルミル基に隣接するプロトン(①,①)の比から,異性体の 存在比は0.53:0.47であった.全プロトンの帰属をTable 3-1に示した.2つ の異性体はTLC,再結晶などの手段では分離できなかったので,以下の実験に は混合物のまま用いた.

# 3.2.2 1-カルボキシプロピルフォルミルピレン修飾キトサン膜の分析

3.1.3項で得られたCPFP修飾キトサン膜のIRスペクトルをFig. 3-6に示す. 12時間反応後には1662cm<sup>-1</sup>にアミドI, 1560cm<sup>-1</sup>にアミドIIの吸収が見ら

れ,48時間反応後には,アミドの吸収以外に 1638cm<sup>-1</sup>にC=N伸縮,1702cm<sup>-1</sup>にCHOの吸収 も見られた.これらのことから,キトサン膜中 でCPFPは,右図のようにキトサン残存アミノ基 とシッフ塩基を形成していることが推定され る.

カバーガラス上に別途調製したキトサン膜を



CPFPで修飾後,乾燥アセトニトリルを満たしたトライアングルセルに入れ て,膜中のCPFP蛍光強度の水による変化を測定した(Fig. 3-7).励起波長 355nmでの470nmにおける蛍光強度は水の濃度増加に従って減少した.おそ らく膜中に取り込まれた水含量増加に伴う親水的なミクロ環境への変化が蛍光 強度の変化を引き起こしているものと思われる.この現象を利用してCPFPキ トサン膜をプローブとする有機溶媒中の微量水分測定用蛍光光ファイバセンサ の作製とその応答特性を検討した.



Wavenumber / cm<sup>-1</sup>

Fig. 3-6 IR spectra of (a) chitosan membrane and the membranes treated with CPFP for (b) 12h and (c) 48h.





#### 3.2.3 有機溶媒中の水含量測定

アセトニトリルおよび水へのセンサの応答をFig. 3-8に示す. アセトニトリ ルおよび水の入ったサンプル管を交互に取り替えることによって繰り返し再現 性を検討した、アセトニトリル中で見られた蛍光は、水中では減少し、約30秒 で一定値を保った.これを繰り返し、1週間30回の測定の相対標準偏差は± 4.8%で、繰り返し再現性、耐久性ともに十分使用可能な値であった.また、 アセトニトリル中水分の検量線をFig3-9に示した.このセンサは、ベンゼン、 ケロセン、ヘキサン中でも同様な応答を示し、それぞれの検量線はFig. 3-10 に示した. 用いた溶媒の比誘電率 εr<sup>18)</sup> がアセトニトリル(37.5), ベンゼン (2.275), ヘキサン(1.880)と小さくなるに従って, それぞれの有機溶媒 中での蛍光強度は強く、また水分に対する応答感度も高くなった. ヘキサンの 場合数ppmレベルでの定量が可能であった.ケロセンは高級炭化水素の混合物 のため正確な比誘電率は不明であるが、炭化水素の比誘電率は炭素数が多くな ると大きくなることから、おそらくベンゼンとヘキサンの間に位置するであろ う.以上のことは、キトサン膜への水の濃縮が試料の有機溶媒との分配比に依 存していることを示唆する. なお、期待したシッフ塩基の加水分解および再生 に伴う蛍光変化のセンサ応答への影響は、一般的にシッフ塩基の生成には酸触 媒を要することや、Fig3-8の応答速度の速さ、特に戻りの速さが数十秒である ことを考えるとほとんど寄与していないと推定される.

#### 3.3 総括

CPFPをアミド結合で修飾したキトサン膜を調製した.この膜からの蛍光 は、微量水分の存在で低下する事を見いだした.キトサン膜の水に対する濃縮 効果がCPFPのミクロ環境を親水的にし、そのために蛍光強度の減少が引き起 こされたものと思われる.この修飾膜を応答部位とする有機溶媒中の微量水分 測定用二股型光ファイバ蛍光センサを作製した.このセンサは誘電率の低い有 機溶媒中での微量水分に対する応答感度が高く、ヘキサン中10ppm以下の水分 測定が可能であった.また、1週間30回の測定の相対標準偏差は±4.8%で、 繰り返し再現性、耐久性ともは十分実用的に使用可能な値であった.以上のこ



Fig. 3-8 Typical responses of the sensor to water and CH<sub>3</sub>CN.



Fig. 3-9 Relationship between the response and water content in CH<sub>3</sub>CN .





とから、サンプリングを伴わない、リアルタイムな有機溶媒中の微量水分分 析、特に石油製品の行程管理等に利用できる可能性があると思われる.

#### 参考文献

- 1) Y.Y. Liang : Anal. Chem., 62, 2504 (1990).
- 2) C. D. Thompson, F. D. Bogar, R. T. Foley : Anal. Chem., 42, 1474 (1970).
- A. T. Pilipenko, E. R. Falendysh, O. M. Drapailo, V. A. Zayats : Zh. Anal. Chim., 44, 51 (1989).
- 4) C. E. Matkovich, G. D. Christian : Anal. Chim. Acta, 60, 319 (1972).
- M. Guzman, J. L. P. Pavon, E. R. Gonzalo, C. Hatfield, J. Ruzicka, G. D. Christian : Analyst, 116, 1043 (1991).
- 6) S. Garrigues, M. Gallignani, M. Guardia : Anal. Chimi. Acta., 281, 259 (1993).
- 7) T. N. Gvozdovich, G. S. Grinberg, L. V. Zuyeva, Ya. I. Yashin : Petroleum Chem., 12, 120 (1972).
- 8) J. M. Hogan, R. A. Engel, H. F. Stevenson : Anal. Chem., 42, 249 (1970).
- 9) R. P. Badoni, A. Jayaraman : Fresenius J. Anal. Chem., 338,745 (1990).
- 10) H. Langhals : Anal. Lett., 23, 2243 (1990).
- 11) S. S. M. Hassan, M. A. Ahmed : Anal. Lett., 24, 817 (1991).
- 12) L. Stefan, G. R. Choppin : Anal. Chem., 63, 2542 (1991).
- 13) H. Huang, P. K. Dasgupta : Anal. Chem., 64, 2406 (1992).
- 14) Y. Kurauchi, K. Ohga : Anal. Sci., 6, 919 (1990).
- 15) T. Uragami, K. Takigawa : Polymer, 31, 668 (1990).
- 16) 身矢 勝, 岩本令吉, 美馬精一, 山下修蔵, 望月 明, 田中善喜:高分子論文集, 42, 139 (1988).
- 17) L. F. Fieser, E. B. Hershberg : J. Am. Chem. Soc., 60, 2542 (1938).
- 18) 日本化学会編:"化学便覧 基礎編"改訂3版,(1984),(丸善).